

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成22年9月9日(2010.9.9)

【公表番号】特表2009-545774(P2009-545774A)

【公表日】平成21年12月24日(2009.12.24)

【年通号数】公開・登録公報2009-051

【出願番号】特願2009-522994(P2009-522994)

【国際特許分類】

G 0 3 F 7/20 (2006.01)

H 0 5 K 3/06 (2006.01)

H 0 5 K 3/18 (2006.01)

H 0 5 K 3/00 (2006.01)

【F I】

G 0 3 F 7/20 5 0 1

H 0 5 K 3/06 E

H 0 5 K 3/18 J

H 0 5 K 3/00 G

【手続補正書】

【提出日】平成22年7月21日(2010.7.21)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

フォトレジスト層を有する誘電体基板を提供することと、
フォトリソグラフィマスクを通して前記フォトレジストの第 1 部分を紫外線に露光することと、

前記誘電体基板を前進させること、及び前記フォトリソグラフィマスクを通して前記フォトレジストの第 2 部分を紫外線に露光することと、を含む方法であって、前記フォトレジストの前記第 2 部分が、前記フォトレジストの前記第 1 部分と部分的に重なり合い、並びに

前記フォトリソグラフィマスクが、配列される回路の区域のパターンを有する、方法。

【請求項 2】

前記誘電体基板を 2 度目に前進させること及び前記フォトリソグラフィマスクを通して前記フォトレジストの第 3 部分を紫外線に露光することを更に含み、前記フォトレジストの前記第 3 部分が、フォトレジストの前記第 2 部分と部分的に重なり合う、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

フォトリソグラフィマスクの長軸に対してある角度をなして配置される複数の回路セグメントを含むパターンを有する前記フォトリソグラフィマスクを有する、物品。